



บทที่ 1

บทนำ

สารกึ่งตัวนำมีคุณสมบัติระหว่างตัวนำและอนวานไฟฟ้า และเป็นคุณสมบัติที่ควบคุมได้ จึงได้มีการศึกษาเพื่อนำเอาสารกึ่งตัวนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ ในราวปี พ.ศ. 1940 Schockley Bardeen และ Brattain⁽¹⁾ ได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้น สำเร็จ จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาแนวความคิดที่จะนำเอาสารกึ่งตัวนำมาประยุกต์สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นิดอื่นๆ

สารกึ่งตัวนำที่ใช้กันอยู่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ธาตุบางตัวใน Group IV ของตารางพีริออดิก ขันได้แก่ ชิลิกอน (Si) เบอร์มันเนียม (Ge) ชิลิกอนเป็นธาตุที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เมื่อจากมีเป็นจำนวนมากและหาได้สะดวก เทคโนโลยีต่างๆ จึงได้นำหนักเกี่ยวกับชิลิกอน

โครงสร้างหลักของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำได้แก่ หัวต่อพี-เอ็น ซึ่งประดิษฐ์สร้างโดยอาศัยกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนลงบนสารกึ่งตัวนำ เทคนิคการแพร่ซึมนี้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ งานวิจัยนี้มุ่งถึงการแพร่ซึมสารเจือปนชนิดพิลลงบนแวนพลิกชิลิกอนแบบเอ็นโดยใช้บอรอนเป็นตัวเติมอะตอมสารเจือปน ทั้งนี้ เพราะบอรอนมีค่าความหนาแน่นของสารเจือปนและความสามารถในการแพร่ซึมในเนื้อชิลิกอนสูงลำบากช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการแพร่ซึม แต่ความสามารถในการแพร่ซึมของอะตอมบอรอนในเนื้อชิลิกอนที่เกิดจากการใช้ตัวเติมสารเจือปนคละชนิด ไม่เท่ากัน

การศึกษาการแพร่ซึมของบอรอนในชิลิกอนเริ่มต้นโดย Dunlap และคณะ⁽²⁾ ในปี พ.ศ. 1954 จากนั้นได้มีผู้ทำการศึกษาลักษณะการแพร่ซึมของบอรอน โดยใช้ตัวเติมสารเจือปนในลักษณะต่างๆ ที่เป็นตัวของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น ไนโตรอัอกไซด์ บอรอนไคร์-ไบรอนไคร์ บอรอนไครคลอไรด์ เป็นต้น และให้ผลการแพร่ซึมในลักษณะต่างๆ กัน โดยยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้ ในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลของการแพร่ซึม โดยใช้เทคนิค

และระบบการแพร์ชีมต่างๆ กัน ด้วยการใช้ตัวเติมสารเจือปนท่ออยู่ในรูปสารประกลบ คือ ไดบอรอน-ไตรออกไซด์ บอรอนไตรโบรมิด และบอรอนไนโตรด์ และประเด็นลัมบส์ที่มุ่งถึงคือ ระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ต้องมีความหลากหลาย ความเหมาะสม และความประยุกต์ในการแพร์ชีม เพื่อทำข้อสรุปจากผลการทดลองไปประกอบการพิจารณา การออกแบบสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ โดยมุ่งเน้นถึงการใช้เครื่องมือที่สร้าง อุปกรณ์และวัสดุที่หาได้ภายในประเทศเป็นสำคัญ

เนื่องจากคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำขึ้นกับ ความลึกและคุณภาพของหัวต่อฯ ลักษณะการกระจายของอะตอมสารเจือปนในชิลิกอน ความเข้มข้นของอะตอมสารเจือปน จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ใน การแพร์ชีม โดยในการรีซันน์แบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้วั่นฟลักที่มีความต้านทานจำเพาะอยู่ในช่วง 0.1-10 โอห์ม-ซม. ทำการแพร์ชีมโดยมีตัวแปรเป็น carrier gas อุณหภูมิ และเวลาในการแพร์ชีม โดยใช้ตัวเติมสารเจือปนทั้ง 3 ชนิด ส่วนที่สองเป็นการทดลองโดยนำเงื่อนไขที่เหมาะสมจากการแพร์ชีมมาออกแบบสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ในที่นี้คือเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งได้จากการแพร์ชีมด้วยสารเจือปนทั้ง 3 ชนิด โดยมีวิธีการประเมินผลการทดลองทั้งหมด ดังนี้ :-

1. การวัดค่าความต้านทานแผ่น เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงความเข้มข้นของอะตอมสารเจือปนที่ผิวน้ำวั่นฟลัก โดยใช้เครื่องไฟฟ้ารุ่น Veeco model FPP-100
2. ความลึกของหัวต่อพี-เอ็น เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการแพร์ชีมของอะตอมสารเจือปนในเนื้อชิลิกอน หัวต่อฯ วัดโดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ โดยการย้อมสีเพื่อถูกความแตกต่างของชั้นพี-เอ็น ด้วยการเชาะเป็นร่องด้วยเครื่องขัดผิว
3. การหาอัมเพียริติปอร์ไฟล์ของชั้นที่แพร์ชีม เพื่อการจัดเรียงของอะตอมสารเจือปนในชิลิกอน โดยสร้างชั้นออกไซด์บางๆ ด้วย anodic oxidation เพื่อลอกผิวชิลิกอนที่ลະชั้น แล้ววัดค่าความต้านทานแผ่นของชั้นที่ลอกทุกรัง เพื่อนำไปหาความเข้มข้นอะตอมสารเจือปนที่คำนวณต่างๆ ในวั่นฟลัก
4. ถูกความสม่ำเสมอของการแพร์ชีม โดยวัดค่าความต้านทานแผ่นตลอดผิวน้ำของวั่นฟลัก

5. ในกรณีของการแพร์ซึมด้วย BBr_3 ต้องหาเงื่อนไขของ carrier gas ที่ศักดิ์สูง
ในการแพร์ซึม โดยวัดค่าความด้านทานแผ่นที่คำนวณต่าง ๆ ในเว้นผลึกด้วยวิธี
anodic oxidation
6. ดูสักษณะกระแสแรงดันของเซลล์ที่สร้าง วัดจาก curve tracer โดยใช้หลอด
แอโรโล Jen ที่มีความเข้มแสง 100 mW/cm^2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเซลล์ที่ได้จาก
การแพร์ซึมด้วยตัวเคมีสารเจือปนทั้ง 3 ชนิด

ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำมาหาเงื่อนไขการแพร์ซึมของบอรอนที่ ทาง
เทคนิคที่เหมาะสมมาใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ และนำมาประยุกต์ใช้ทำสิ่งประดิษฐ์หัวต่อชนิด
พิบันเอ็นที่มีประโยชน์ต่องานด้านวิศวกรรม เช่น ไคโอด ทรานซิสเตอร์ สิ่งประดิษฐ์อิเลคทรอนิกส์-
ไฟฟ้ากำลัง (Power Electronic Devices) เป็นต้น